

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】令和 3 年 2 月 25 日 (2021.2.25)

【公表番号】特表 2020-507678 (P2020-507678A)

【公表日】令和 2 年 3 月 12 日 (2020.3.12)

【年通号数】公開・登録公報 2020-010

【出願番号】特願 2019-542079 (P2019-542079)

【国際特許分類】

C 2 3 C 16/52 (2006.01)

H 0 5 H 1/46 (2006.01)

C 2 3 C 16/50 (2006.01)

H 0 1 L 21/3065 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 16/52

H 0 5 H 1/46 A

C 2 3 C 16/50

H 0 1 L 21/302 1 0 1 B

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 1 月 13 日 (2021.1.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

調整可能なワークピースバイアス用システムであって、
 ワークピースにプラズマ処理を実施するプラズマチャンバと、
 前記プラズマチャンバ内で、ワークピースに直接に結合され、ワークピースの上方に位置する電極と結合された第 1 のパルス電圧源と、
 前記ワークピースに容量結合された第 2 のパルス電圧源と、
 前記ワークピースに向けられたイオンフラックスのイオンエネルギー分布を調整するために、前記第 1 のパルス電圧源及び前記第 2 のパルス電圧源の 1 つ以上のパラメータに基づいて、前記第 1 のパルス電圧源及び前記第 2 のパルス電圧源を独立に制御するバイアス制御装置とを備えるシステム。